

# 高纯全新料聚四氟乙烯方槽 耐酸浸泡槽 定制含氟聚合物清洁容器

货号: PL-CP410



## 简介

采购专为极端耐化学腐蚀设计的高纯全新料聚四氟乙烯方槽与酸浸槽，我们定制加工的含氟聚合物容器可实现零污染，兼具出色热稳定性，满足半导体和痕量分析实验室的严苛应用要求，可按需定制报价。

## 了解更多

应用场景	说明	核心优势
半导体晶圆蚀刻	作为氢氟酸浴容器，用于去除硅片氧化层。	零金属污染，确保高良品率。
痕量金属分析	在浓硝酸中对实验器皿（烧杯、样品瓶、试管）进行预清洁浸泡。	本底极低，保证ppt级检测精度。
药物合成	作为高反应活性中间化学品与溶剂的反应容器或存储容器。	符合FDA要求的材料惰性，避免产品降解。
航空零部件清洁	使用强化学脱漆剂对精密发动机部件进行脱脂与脱氧处理。	可长期耐受工业强清洁剂腐蚀。
电池研究	用于先进锂离子电池与固态电池测试的电解液存储与电极浸泡。	电化学稳定，不会干扰测试数据。
电镀与表面处理	用于贵金属沉积或阳极氧化工艺的小型电镀槽。	热分布均匀，耐电镀盐腐蚀。
地质样品消解	用于地球化学勘探中大批量矿物与土壤样品的酸消解处理。	耐高温性能，加快消解进程。

特性	规格参数 (型号 PL-CP410)
核心材料	高纯全新料聚四氟乙烯 (PTFE)
生产工艺	全CNC数控加工 / 定制加工
可选型号范围	PL-CP410 (定制系列基础编号)
化学兼容性	通用耐腐 (熔融碱金属与特殊氟化合物除外)
工作温度	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)
尺寸范围	全可定制 (宽度、长度、深度可按需求定制)
壁厚	可根据容积与结构要求定制
盖板配置	可选: 平松配式、螺纹式、O型圈密封盖板
表面光洁度	高精度机加工表面 (可提供Ra < 0.8µm光洁度)
可选配置	集成排水口、聚四氟乙烯阀门、内部分隔、提篮